

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 11 月 6 日(06.11.2014)



(10) 国際公開番号

WO 2014/178371 A1

(51) 国際特許分類:

A61K 8/31 (2006.01) A61Q 19/10 (2006.01)
A45D 44/00 (2006.01) C11D 1/66 (2006.01)
A47K 7/00 (2006.01) C11D 3/18 (2006.01)
A61K 8/02 (2006.01) C11D 3/20 (2006.01)
A61K 8/33 (2006.01) C11D 3/37 (2006.01)
A61K 8/81 (2006.01) C11D 3/43 (2006.01)
A61Q 1/14 (2006.01) C11D 17/04 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2014/061856

(22) 国際出願日: 2014 年 4 月 28 日(28.04.2014)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

特願 2013-096092 2013 年 4 月 30 日(30.04.2013) JP
特願 2013-096093 2013 年 4 月 30 日(30.04.2013) JP
特願 2013-116492 2013 年 5 月 31 日(31.05.2013) JP

(71) 出願人: 花王株式会社 (KAO CORPORATION)
[JP/JP]; 〒1038210 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 1 番 1 0 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 山田 晃平(YAMADA, Kouhei); 〒1318501 東京都墨田区文花 2 丁目 1 番 3 号 花王株式会社研究所内 Tokyo (JP). 友國 敦史(TOMOKUNI, Atsushi); 〒1318501 東京都墨田区文花 2 丁目 1 番 3 号 花王株式会社研究所内 Tokyo (JP). 田中 幸司(TANAKA, Koji); 〒1318501 東京都墨田区文花 2 丁目 1 番 3 号 花王株式会社研究所内 Tokyo (JP). 澤 大輔(SAWA, Daisuke); 〒1318501 東京都墨田区文花 2 丁目 1 番 3 号 花王株式会社研究所内 Tokyo (JP). 川合 隆(KAWAI, Takashi);

〒3213497 栃木県芳賀郡市貝町赤羽 2 6 0 6
花王株式会社研究所内 Tochigi (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人アルガ特許事務所 (THE PATENT CORPORATE BODY ARUGA PATENT OFFICE); 〒1030013 東京都中央区日本橋人形町 1 丁目 3 番 8 号 沢の鶴人形町ビル Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: SKIN CLEANSER COMPOSITION

(54) 発明の名称: 皮膚洗浄剤組成物

(57) Abstract: Provided is a skin cleanser composition that comprises the following components (A), (B), (C), (D), and (E): 0.1-25 mass% of an ether oil (A) that is a liquid at 25 °C; 0.003-1 mass% of a water-soluble polymer (B) that includes acrylic acid or methacrylic acid as a constituent unit thereof; 1-30 mass% of a hydrocarbon oil (C) that has a viscosity of 15 mPa·s or less at 30 °C; 60-95 mass% of water (D); and 0.49 mass% or less of a non-ionic surfactant (E) having an HLB that is greater than 9. The mass ratio (B)/(A) of the components (A) and (B) is 0.0001-0.1 and the mass ratio (A)/((A)+(C)) of the components (A) and (C) is 0.05-0.9.

(57) 要約: 次の成分 (A)、(B)、(C)、(D) 及び (E): (A) 25 °C で液状のエーテル油 0.1 ~ 25 質量%、(B) アクリル酸又はメタクリル酸を構成単位として含む水溶性ポリマー 0.003 ~ 1 質量%、(C) 30 °C における粘度が 15 mPa · s 以下の炭化水素油 1 ~ 30 質量%、(D) 水 60 ~ 95 質量%、(E) HLB が 9 より大きい非イオン界面活性剤 0.49 質量%以下を含有し、成分 (A) と成分 (B) の質量割合 (B) / (A) が、0.0001 ~ 0.1 であり、成分 (A) 及び (C) の質量割合 (A) / ((A) + (C)) が、0.05 ~ 0.9 である皮膚洗浄剤組成物。

WO 2014/178371 A1